

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】令和 1 年 12 月 5 日 (2019.12.5)

【公開番号】特開 2019-54130 (P2019-54130A)

【公開日】平成 31 年 4 月 4 日 (2019.4.4)

【年通号数】公開・登録公報 2019-013

【出願番号】特願 2017-177786 (P2017-177786)

【国際特許分類】

H 0 5 K 1/02 (2006.01)

H 0 5 K 3/46 (2006.01)

【 F I 】

H 0 5 K 1/02 P

H 0 5 K 3/46 Z

H 0 5 K 3/46 N

【手続補正書】

【提出日】令和 1 年 10 月 21 日 (2019.10.21)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 2 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 1 2 9 】

図 3 D の実線および仮想線で示すように、次いで、クロム（熱膨張係数 6.8 (ppm/K) ）からなり、厚み T_a が 30 nm である密着層 8 をスパッタリング法により形成し（第 4 工程）、続いて、銅（熱膨張係数 16.8 (ppm/K) ）からなり、厚み T_b が 120 nm である本体層 9 をスパッタリング法により形成した（第 5 工程）。これにより、平坦部 21 および凹部 22 を有するシールド層 5 を形成した。なお、シールド層 5 は、まだ、シールド開口部 27 を有しておらず、つまり、密着層 8 を、中間絶縁層 4 の上面全面と、シールド層 5 の内側面 10 と、中間開口部 15 から露出する延出部 16 の上面とに、連続して形成し、また、本体層 9 を、密着層 8 の上面全面に形成した。